# 酸化亜鉛系B領域紫外線センサーの開発 Development of Zinc Oxide Based Ultraviolet Light-B Sensor 1255049 秦 睦人 (機能性薄膜工学研究室) (指導教員 牧野 久雄 教授)

## 1. 研究背景

紫外線(Ultraviolet: UV)には、自然光と人工光があり、波長 によって3つの領域、UV-A(320~400 nm)、UV-B(290~320 nm)、 UV-C(190~290 nm)に分けられる。人体に影響を与えるのは主 に UV-B 以下の波長領域とされている。従来の UV センサー は高価なガリウムヒ素(GaAs)が主だったが、バンドギャップ が 3.37eV である ZnO は Mg 添加により UV-B 領域へのワイ ドギャップ化が可能であり[1]、紫外線領域にのみ感度を持ち 可視光フィルターが不要となるなどの優位性がある。また、 ZnO には Zn 極性面と O 極性面とがあり、添加元素の取り込 みや物性に大きな影響を与える[2]。しかし、ZnO 多結晶薄膜 の光導電特性に対する極性の影響を検討した報告例はない。 そこで、本研究では、ガラス基板上での ZnO 薄膜の極性制御 及び極性による光導電特性の違いを明らかにすること、光導 電型センサーの課題である減衰時間の改善、MgZnO を用いて UV-B 領域以下に感度を持つガラス基板上での酸化亜鉛系紫 外線センサーの開発について検討した。

## 2. 実験方法

ガラス基板上に RF マグネトロンスパッタ法でスパッタガ スとして Ar ガスを用い、基板温度 300℃で ZnO 薄膜を成膜 した。また、減衰時間の改善のため成膜時に O2 を導入し減衰 時間が遅い原因である酸素空孔の減少を図った。本研究では Al 下地層による極性制御を試みた。Al 下地層は RF 重畳 DC マグネトロンスパッタ法で成膜し、膜厚を 1 nm とした。 MgZnO 薄膜は、Ar ガスのみとし、基板温度 200℃、250℃、 300℃で成膜した。光学特性評価には分光透過率・反射率測定 を行った。光導電特性の評価には、電流の時間変化測定(I-t 測 定)を行った。 照射 UV 光は、波長 365 nm、 強度約 0.525 mW、 波長 310 nm、強度約 0.21 mW とした。また、雰囲気の影響を 調べるため UV 照射中、照射後に N2 ガスを吹き付けて光導電 特性の評価を行った。

## 3. 実験結果と考察

図 1 に (a) Ar のみで成膜した ZnO 膜(Ar 成膜)と(b)O<sub>2</sub>を導 入した ZnO 膜(Ar +O2 成膜)の波長 365 nm の UV 光に対する 感度を示す。ここでは Zn 極性の結果を示した。成膜時に O2 を導入することによって、極性に関係なく高抵抗化され、暗 電流が低下するとともに、O極性では約1.06から約1.6に、 Zn 極性では約1.02 から約1600 まで感度が大きく上昇した。 また、Ar のみで成膜した場合の減衰時間は、O 極性では 69 秒、Zn極性では134秒でセンサーとしては遅い結果であった。 成膜中に O<sub>2</sub> を導入することで減衰時間は O 極性では 9 秒、 Zn極性では6秒と大幅に改善した。立ち上がりの応答時間も 10 秒以内の特性を示した。また、極性による光導電特性の違 いとしては、Zn極性は暗電流まで下がりきったが O極性では 非常に遅い成分が残った。

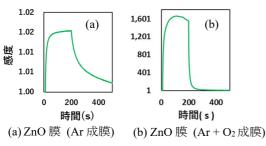


図1 感度 (Zn 極性)

次に、基板温度を 200℃、250℃、300℃と変えて MgZnO 膜 を成膜し、光源 365 nm、310nm の UV 光照射による電流の時 間変化測定を行った。基板温度の上昇とともに MgZnO 膜の バンドギャップが大きくなり、300℃成膜において波長310 nm の光源でのみ応答した。バンドギャップ励起によるプロセス が関与して光応答していることがわかった。また、300℃での MgZnO 膜では約 1.0 秒と ZnO 膜よりも速い減衰時間を得る ことができた。

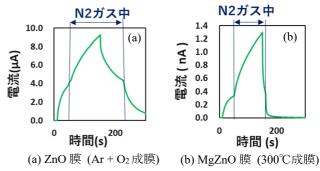


図2N2ガス中の光導電特性

図 2 に (a) O<sub>2</sub>を導入した ZnO 膜(Ar +O<sub>2</sub>成膜)と(b) MgZnO 膜(300°C)のサンプルに UV 照射中、照射後に  $N_2$  ガスを吹き付 けて電流の時間変化を示す。応答時間は N2 ガス中で遅くなり、 ZnO 膜(Ar +O2 成膜)は55 秒、MgZnO 膜 は56 秒とほぼ同じ 速度になった。これは、表面 O2 の脱離と O2 吸着の抑制によ ると考えられる。減衰時間については、ZnO膜(Ar +O2成膜) は、 $N_2$  ガス中で ZnO 膜(Ar 成膜)と同程度まで遅くなったが、 MgZnO 膜では N<sub>2</sub> ガスの影響をほぼ受けなかった。このよう に、大気中で速い応答、減衰時間を示す2つのサンプルだが、 N2 ガス中での振る舞いに違いがあることがわかった。減衰時 間は、O2を導入したサンプルで Ar 成膜と同程度になったの は実際には酸素空孔は減少せずにその影響が顕在化したと考 えた。大気中で減衰が速くなったのは表面 O2 の吸着が速くな ったためと考えられる。一方、MgZnO 膜では ZnO 中の Mg は Oを取り込みやすく酸素空孔を減少させる働きがあり[3]、サ ンプル中の酸素空孔が減少し減衰時間が N2 ガスの影響を受 けず変わらず速い特性を示したと考えられる。

## 4. まとめ

マグネトロンスパッタ法によるガラス基板上の ZnO 膜において、 1.0 nm の Al 下地層の挿入により極性の制御を達成し、極性によ る光導電特性の違いについて明らかにした。成膜時に O2 を導入 することで光導電型センサーの課題である減衰時間の改善を達 成した。ガラス基板上で MgZnO を用いた紫外線センサーとして Ar ガスを用い、基板温度 300℃での MgZnO 膜で UV-B 領域以 下に感度を持つ紫外線センサーを達成した。

#### 参考文献

[1] A. Ohtomo, et al, Appl. Phys. Lett. 72, pp.2466-2468, (1998) [2]Y.Adachi, et al., Phys. Status. Solidi, B250, No. 10, 2122–2125 (2013) [3]Y. Ogawa, et al., phys. stat.sol.(a)202, No. 9, pp. 1825–1828, (2005)